

1 ページ目

(項目の加除変更はできません)

- *課題番号 : 京大での課題 ID (Web登録時前に京大から指定します)
- *利用形態(主) : 技術相談・機器利用・技術補助・技術代行・共同研究・データ利用 ← 一つを選択
利用形態(副) : 技術相談・機器利用・技術補助・技術代行・共同研究・データ利用 ← 一つを選択
- *利用課題名 :
- *課題申請者名 :
- *所属機関名 :
- 課題申請者情報 :
- ORCID : 未所得者は取得をお勧めします
- *年齢層 : 20 代以下、30 代、40 代、50 代以上 ← 公開はしない
- *所属機関区分 : 大学、公的機関、大企業、中小企業 ← 公開はしない
- *公開猶予希望(公開猶予は原則 2 年まで) : なし あり(公開猶予期間: yy/mm/dd)
- その他利用者名 :
- ARIM 担当者名 : 京大装置担当者
- *横断技術領域(主) : 計測・分析 加工・デバイスプロセス 物質・材料合成 計算科学・シミュレーション ← 京大が選択
横断技術領域(副) :
- 計測・分析 加工・デバイスプロセス 物質・材料合成 計算科学・シミュレーション ← 京大が選択
- 利用した設備の ID 番号 : 主な装置を記載 装置 ID は添付資料を参照してください
- キーワード : フリーキーワードです (複数の場合は、半角カンマ区切りでお願いします)

*概要(Summary) :

*実験(Experimental) :

図、表は 2 ページ目に記載

*結果と考察(Results and Discussion) :

最低100字

*その他・特記事項(Others) :

研究成果を公開される場合は、謝辞の記載をお願いいたします。 和文 : 本研究 (の一部) は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」事業 (京大例 課題番号 : JPMXP1222KT**** の支援を受けた。最後の 4 桁は京大で記載 英文 : (A part of) This work was supported by “Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan (ARIM)” of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) Grant Number JPMXP1222KT****

*論文・プロシーディング(DOI も記入) :

DOI が付けられていない論文等については、DOI が付けられてから追記をお願いします

DOI が付かない論文は、口頭発表などの欄に記入して下さい

口頭発表など 1 行づつ改行して、入力下さい。

関連特許 「出願」または「特許」とのみ記載 (出願番号等は記載不用)

図、表はこのページに記載